

# Penna Aspiratrice Per Wafer Peek Antistatica Ad Alta Precisione Per La Movimentazione Di Substrati Da 8 Pollici Nel Settore Semiconduttore E Fotovoltaico

Numero articolo: PL-CP115



## introduzione

Penna aspiratrice per wafer PEEK antistatica ad alte prestazioni progettata per la movimentazione di precisione di wafer da 8 pollici nel settore semiconduttore e fotovoltaico. Questa soluzione personalizzabile offre resistenza chimica superiore e durabilità meccanica per ambienti di camera bianca critici e processi di trasferimento di substrati delicati.

[Ulteriori informazioni](#)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Ispezione wafer	Trasferimento manuale di wafer di silicio da 8 pollici da e verso stazioni di ispezione ottica o SEM.	L'area di contatto minima riduce il rischio di generazione di difetti superficiali.
Selezione celle fotovoltaiche	Movimentazione e selezione di celle solari ad alta efficienza durante le fasi di assemblaggio e collaudo.	Previene le microfratture e mantiene l'efficienza della cella grazie alla presa a vuoto delicata.
Lavorazione su banco umido	Trasferimento di substrati tra bagni chimici o stazioni di risciacquo in ambienti di chimica umida.	Eccezionale resistenza a sostanze chimiche di processo aggressive e all'umidità.
Deposizione di film sottili	Posizionamento e rimozione di substrati da camere a vuoto PVD/CVD o serrature di carico.	L'elevata stabilità termica consente la movimentazione dopo cicli di deposizione ad alta temperatura.
Ricerca e sviluppo in camera bianca	Movimentazione generale di substrati nelle strutture di ricerca e sviluppo di materiali avanzati.	Mantiene standard di pulizia ISO stretti minimizzando la perdita di particelle.
Preparazione per die bonding	Posizionamento manuale di wafer per operazioni di dicing o successive operazioni di die bonding.	Le proprietà antistatiche prevengono difetti latenti nei microcircuiti sensibili.
Movimentazione substrati LED	Manipolazione di precisione di substrati di zaffiro o SiC durante la fabbricazione di chip LED.	Presa sicura su superfici dure e lucidate senza slittamenti o graffi.

Categoria di specifica	Dettaglio specifica PL-CP115
Identificazione modello	Serie PL-CP115
Materiale principale	PEEK antistatico ad alte prestazioni
Compatibilità substrati	Completamente personalizzabile (ottimizzato per wafer da 8 pollici/200 mm)
Resistenza superficiale	Personalizzabile in base a intervalli antistatici specificati (es. $10^6 - 10^9 \Omega$ )
Intervallo di temperatura di funzionamento	Personalizzato in base ai requisiti di processo
Compatibilità chimica	Universale (elevata resistenza alla maggior parte di acidi, basi e solventi)
Tipo di connessione per vuoto	Dimensione su misura per adattarsi a linee di vuoto dell'impianto o pompe portatili

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Categoria di specifica	Dettaglio specifica PL-CP115	
Configurazione punta	Forme personalizzate (piatta, curva, multipunto) disponibili su richiesta	
Grado camera bianca	Compatibile con ISO Classe 3 - 8 (dipendente dall'applicazione)	
Metodo di fabbricazione	Lavorazione CNC di precisione secondo specifiche su misura	
Dimensioni impugnatura	Adattata ergonomicamente alle preferenze del cliente	